

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

高解像度で優れた耐ドライエッチング性及び基板との密着性を有し、しかもラインエッジラフネスが改善された良好な形状のレジストパターンを与える化学増幅型ポジ型レジスト組成物を提供する。

(A) 酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分、(B) 放射線の照射により酸を発生する酸発生剤成分及び(C) 有機溶剤を含むポジ型レジスト組成物において、(A) 成分として、主鎖を構成するモノマー単位が溶解抑制基をもつアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステル単位、アクリル酸又はメタクリル酸とラクトン環含有橋かけ型飽和多環式アルコールとのエステルから誘導されるモノマー単位及びアクリル酸又はメタクリル酸とヒドロキシ基、アルコキシ基又はアシル基で置換された直鎖状アルコールとのエステルから誘導されるモノマー単位から構成された共重合体を用いた化学増幅型ポジ型レジスト組成物とする。

09993627.1.12701